

CARE

JESINE
洁芯半导体
JESINE SEMICONDUCTOR

Catalyst Referred Etching

催化材料表面基准蚀刻机 CARE



0.1纳米级加工

无产生加工变质层

超精密表面平坦化设备

第一代



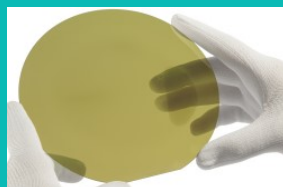
Si Ga

第二代



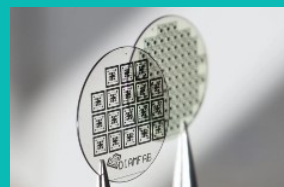
**GaAs InP
LT LN**

第三代



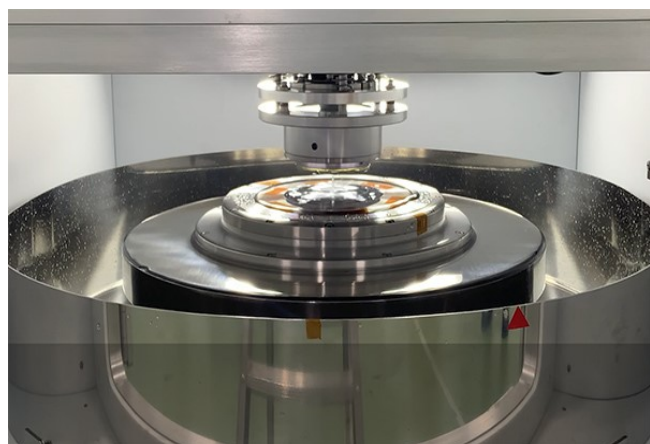
**SiC
GaN**

第四代

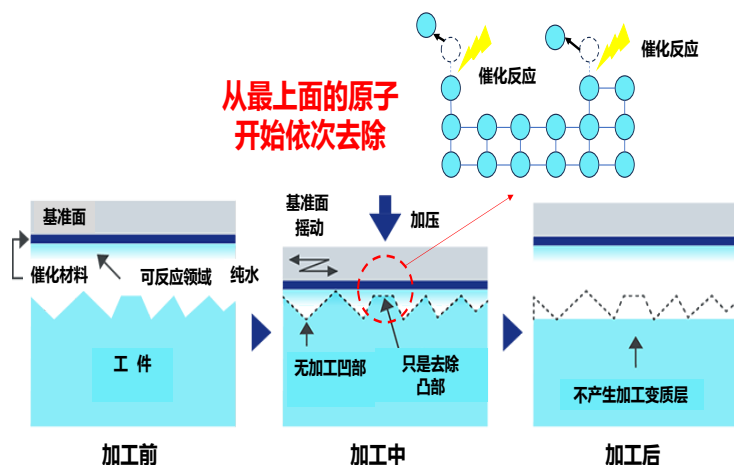


**Ga₂O₃
Diamond**

加工平台



加工原理



加工案例

